# 溅射 NiCrAlY 涂层氧化过程 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 膜结构与形貌的转变

李美姮<sup>1</sup> 孙晓峰<sup>1</sup> 张重远<sup>1</sup> 胡望宇<sup>2</sup> 管恒荣<sup>1</sup> 胡壮麒<sup>1</sup>

(1. 中国科学院金属研究所 沈阳 110016; 2. 湖南大学材料科学与工程学院 长沙 410082)

摘要 对溅射 NiCrAl Y 涂层进行了 900 ,1000 ,1100 空气中高温氧化。实验表明,氧化初期生成快速长大的 亚稳态 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 相,随着氧化时间延长, - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 逐渐转变成 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>,氧化动力学抛物线常数  $k_p$  也随之下降。

- Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 相变速度与温度有关,温度越高,相变越快。对涂层进行真空热处理可促进 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 转变,使涂层 表面快速形成保护性能优异的 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>。

关键词 溅射 NiCrAl Y 涂层 高温氧化 相变 真空热处理

**中图分类号 文献标识码** A 文章编号 1002-6495(2002)03-0142-05

## PHASE AND MORPHOLOGY TRANSFORMATION OF Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> DURING OXIDATION OF SPUTTERED NICEALY COATINGS

LI Meiheng<sup>1</sup>, SUN Xiaofeng<sup>1</sup>, ZHANG Zhongyuan<sup>1</sup>, HU Wangyu<sup>2</sup>, GUAN Hengrong<sup>1</sup>, HU Zhuangqi<sup>1</sup> (1. Institute of Metal Research, The Chinese Academy of Sciences, Shenyang 110016; 2. College of Materials Science and Engineering, Hunan University, Changsha 410082)

**ABSTRACT** The isothermal oxidation of sputtered NiCrAl Y coatings was performed in air at 900 , 1000 and 1100 . Transient alumina -  $Al_2O_3$ , with fast growing rate, was formed on the surface of the coatings in the initial stage of oxidation. With oxidation time increasing , -  $Al_2O_3$  transformed into -  $Al_2O_3$ , and hence the parabolic rate constant decreased. The higher the temperature, the faster the transformation of -  $Al_2O_3$  into -  $Al_2O_3$ . A pre - heat treatment of the sputtered NiCrAl Y coatings in vacuum can accelerate the transformation of -  $Al_2O_3$  into -  $Al_2O_3$ , and there with the protective -

 $Al_2O_3$  scale is formed more rapidly on the surface of the coatings.

**KEY WORDS** sputtered NiCrAl Y coating ,high temperature oxidation ,phase transformation ,vacuum heat treatment

MCrAlY包覆涂层以其优异的抗高温氧化、抗 热腐蚀性能、较高的塑性和与基材间较好的结合性 能等而广泛用于高温合金表面防护<sup>[1]</sup>.在高温氧化 过程中,MCrAlY包覆涂层生成的氧化物主要是 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.本文用磁控溅射方法沉积 NiCrAlY涂层,研 究了高温下 NiCrAlY涂层氧化膜中 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 结构与形 貌的变化,以及真空热处理对涂层氧化行为的影响.

### 1 实验方法

试样基材为一种镍基单晶高温合金,其主要成分

收到初稿:2001-05-25

Tel :024 - 23843531 - 55432 E - mail :mhli @imr. ac. cn

是 (mass %): Ni - 6.5Cr - 5.8Al - 1W - 8.4Mo - 6.7Ta.经真空熔炼拉制成单晶试棒后,加工成 15 mm ×5 mm 圆片.用磁控溅射方法在基材表面沉积 NiCrAlY涂层,溅射靶材的成分为 Ni - 30Cr - 12Al - 0.3Y.溅射参数为:氩气压力 0.2 Pa,功率 2.1 kW~ 2.4 kW,基体温度 250 ,涂层厚约 20 μm.部分样品 在 5 ×10<sup>-5</sup>真空室中进行 1000 /4 h 的热处理.

恒温氧化实验在配有德国 4410 型 SARTO-RIUS 显微热天平的 TGA 系统中进行,天平感量为 1 µg.试样通过铂-铑丝悬挂于热天平的一端,并置 于炉中的石英管内.实验温度为 900 、1000 和 1100 ,氧化时间 100 h,自动连续测出试样的氧化 增重.为观察样品表面氧化膜,同时在箱式电阻炉中 进行 900、1000、1100 不同时间的恒温氧化.

作者简介:李美姮,女,1969年生,博士生



Fig. 1 Oxidation kinetics of sputtered NiCrAlY coating at 900 ,1000 ,1100 for 100 h

用扫描电镜(SEM)、X - 射线衍射(XRD)、能谱 分析(EDS)等实验手段对试样进行分析.

#### 2 实验结果

#### 2.1 溅射 NiCrAIY 涂层的恒温氧化动力学

图 1 是溅射 NiCrAlY涂层在 900 、1000 、 1100 静态空气中的氧化动力学曲线.可以看到,涂 层在 900 和 1000 表现出相类似的增重规律,即 氧化初期增重迅速,在随后的时间里氧化增重平缓, 只是 900 条件下经初期迅速增重后,动力学曲线 更趋于"渐近水平线",增重更缓慢.而在 1100 氧 化,初期增重迅速现象不明显,在前 24h 内,氧化增 重比 900 和 1000 条件下还小.

为了评价氧化速度的快慢,根据 (m/A)<sup>2</sup> ~ *T*曲线斜率确定氧化速率常数  $k_p$ .其中 m 为氧化 增重, A 为样品的总面积, T 为氧化时间.表 1 是溅 射 NiCrAl Y 涂层暴露在 900 、1000 、1100 氧化 稳定前后的氧化速率常数  $k_p$ .

从表 1 可以看出, 溅射 NiCrAl Y 涂层在 900 、 1000 氧化动力学不符合抛物线规律, 氧化初期 *k<sub>p</sub>* 值较大, 氧化一段时间后变低. 900 氧化初期 *k<sub>p</sub>*比 稳定后高一个数量级; 1000 时, 氧化后期的氧化速

Table 1 Oxidation rate constant  $k_p$  of sputtered coating exposed to 900,1000 and 1100

Oxidation	$k_{\rm p}$ before stabilization	$k_{\rm p}$ after stabilization
temperature	of oxidation	of oxidation
	$g^2/cm^4s$	$g^2/cm^4s$
900	7.56 ×10 <sup>-13</sup>	2.21 ×10 <sup>-14</sup>
1000	5.79 ×10 <sup>-13</sup>	1.73 ×10 <sup>-13</sup>
1100	3.6 ×10 <sup>-13</sup>	3.6 ×10 <sup>-13</sup>



Fig. 2 XRD patterns of oxidation products formed on the sputtered NiCrAl Y coating after various time of oxidation at 900

率常数  $k_p$  约为初期的  $1/4 \sim 1/3$ . 涂层氧化速率常 数  $k_p$  的变化虽然不如 NiAl 那么剧烈<sup>[2]</sup>,但可能也 是氧化机理发生改变的一种迹象,如从亚稳态的 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 转变成稳态的 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 膜. 1100 氧化时,  $k_p$ 值随时间几乎保持不变,说明氧化曲线基本符合" 抛 物线 "长大规律;  $k_p$  值比 900 、1000 初期的  $k_p$  值 小,但比 900 、1000 氧化稳定后的  $k_p$  值大.

#### 2.2 氧化膜 XRD 相分析

由图 2 溅射 NiCrAl Y 涂层 900 氧化不同时间的 XRD 分析结果可以看出 ,5 h 后氧化膜主要是

- Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>,100h 后 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>的(202,200)衍射峰增强,并且出现一定量的 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>,表明 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>向 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>转变.205 h 后, - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 衍射峰增强,涂层 表面氧化膜中除了稳态的 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>外,还有大量的 非稳态 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>,表明在900 氧化, - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>向 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>相转变是一个十分缓慢的过程.

溅射涂层 1000 氧化不同时间的 XRD 图谱如 图 3 所示. 1 h 后,氧化物为 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>; 10 h 后 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(202,200)衍射峰变强,同时出现了少量



Fig. 3 XRD patterns of oxidation products formed on the sputtered NiCrAl Y coating after various time of oxidation at 1000



2θ, deg.

Fig. 4 XRD patterns of oxidation products formed on the sputtered NiCrAl Y coating after oxidation at 1100 for (a) 15 minutes and (b) 1h



Fig. 5 SEM images of sputtered NiCrAl Y coating after oxidation at 900 for (a) 5 h, (b) 100 h, and (c) 205 h



Fig. 6 SEM images of sputtered NiCrAl Y coating after oxidation at 1000 for (a) 1 h, (b) 10 h, (c) 50 h, and (d) 100 h

- Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>;50 h 后, - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(202,200)衍射峰已经 变弱, - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>的衍射峰变强;100 h 后 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>的 (202,200)衍射峰基本消失,氧化物中只剩下 -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.由图 3 可见,涂层氧化初期生成快速长大的 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>,随着氧化时间的延长, - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>逐渐转变 成 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>,到氧化后期氧化膜中只有缓慢生长的 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>膜,这与涂层氧化动力学是相一致的.





Fig. 7 SEM images of sputtered NiCrAl Y coating after oxidation at 1100 for (a) 15 min and (b) 1 h

溅射涂层 1100 氧化 15 min 后, XRD 分析显示(图 4),氧化膜中既存在 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 又存在 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>;1 h 后,氧化物中只有 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.5 h 和 100 h 后的氧化膜中也均唯有 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>,说明在 1100 条件下 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>向 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>转变非常迅速.

#### 2.3 氧化膜的表面形貌观察

溅射 NiCrAlY涂层 900 氧化 5h 后,氧化膜薄 而平坦,仔细观察发现氧化膜晶粒呈针状(needle like)(图 5a),是典型的 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 形貌<sup>[2]</sup>,XRD 分析 也证实(图 2)了随着氧化时间的延长,氧化膜增厚, 100 h 后氧化膜晶粒变粗大,呈针状晶须(whisker), 见图 5b. 205 h 后,氧化膜继续增厚,其晶粒长成更 丰满的刀片状(blade - like),见图 5c.

溅射 NiCrAlY涂层 1000 氧化的表面形貌也 取决于氧化时间(图 6).1h 后表面氧化物晶粒呈针 状(图 6a);10 h 后呈针状晶须(图 6b);50 h 后,针状 晶须长得更丰满并簇拥成团(图 6c);100 h 后形成 一层非常致密比较平整的氧化膜(图 6d).

1100 氧化 15 min,仍可观察到表面氧化膜有少量呈针状的 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(图 7a),只是比 900、1000 氧
 化初期观察到的氧化膜晶粒更呈颗粒状,1 h 后氧化

膜晶粒已呈颗粒状的 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (图 7b),进一步证明 1100 条件下 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>向 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 转变非常迅速.

2.4 对涂层进行真空热处理后氧化膜中的 Al2O3 行为

XRD 分析表明,经真空热处理涂层 1000 氧化 1 h 形成的氧化物是 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>,不存在 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(图 8),相对应的表面形貌呈等轴晶状,而不是针状(图 9a);10h 后,仍只有 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>,无 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>,此时表 面形貌已呈颗粒状(图 9b).表明对溅射 NiCrAl Y涂 层进行真空热处理可促进 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>向 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>转 变,加速涂层表面生成保护性的 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.



Fig. 8 XRD patterns of oxidation produces formed on vaccum heat - treated coating after oxidation in air at 1000 for (a) 1 h and (b) 10 h



**Fig. 9** SEM images of the vaccum heat - treated coating after oxidation in air at 1000 for (a) 1 h and (b) 10 h

#### 3 讨论

Brumm 等人<sup>[3]</sup>详细地研究了 NiAl 和 NiAl - Cr 合金在 700 ~ 1400 的氧化行为,指出 NiAl 在 900 氧化 10 h 后,表面氧化膜发生 -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 相变,并对氧化动力学产生影响. 当形成针状 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 后,氧化增重迅速,氧化速率常数 *k<sub>p</sub>* 增大. 900 条件下, - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 转变缓慢,1000 以上转 变却非常快,并伴随 *k<sub>p</sub>* 值下降.当 NiAl 中加 Cr 后, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 的相变加快.

Doychak<sup>[4]</sup>用透射电镜研究了 - NiAl 的瞬态 氧化过程,发现 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>具有层错结构,层错的界 面为  $Al^{3+}$ 快速扩散提供了短路通道. Schumann<sup>[5]</sup>则 认为 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 具有孪晶结构,孪晶界面是离子快速 扩散的通道. Doychak 和 Schumann 尽管存在分歧, 但都支持一个观点: - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 内存在大量的面缺 陷,为离子的快速扩散提供短路通道,使氧化物沿某 一晶面快速生长.实际上, - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>的生长形貌就 - Al<sub>2</sub>O3 相变发 是短路扩散的间接证据.关于 生的位置,目前有两种相反的看法. Doychak 等人<sup>[6]</sup> 认为,  $- Al_2O_3$ 向  $- Al_2O_3$ 的转变发生在氧化物/ 气相自由表面,相变前沿向氧化膜内部移动,而 Schumann 等人<sup>[5]</sup>则认为 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 向 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 转 变发生在氧化物/金属界面上, - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 在氧化物 的最内层开始生长.

本实验在 900 ~ 1100 温度范围内观察到 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>向 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>的转变.900 条件下转变时间 很长,205 h 后,还存在大量的 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.温度升高, 转变加快,当温度达 1100 时,转变非常迅速,1 h 就基本转变完全,因此在氧化动力学曲线上不容易 反映出来.900 、1000 氧化过程中首先生成亚稳 态的 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>,由于亚稳态 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>的短路通道使 其快速生长,氧化增重非常快.随着亚稳态 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 转变成 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>,形成致密的保护性氧化膜,从而 抑制了氧离子和金属离子在氧化膜中的扩散,氧化 速率下降,氧化增重曲线趋于平缓.1100 条件下, 很快形成 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>,其生长速率比 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>的慢, 因此在前 24 小时内,1100 的氧化增重比 900 、 1000 的还小(图 1).

溅射 NiCrAl Y 涂层 900 、1000 氧化过程中存在 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 相变.900 氧化 205 h 和 1000

氧化 50 h 后,从表面形貌观察,氧化膜呈刀片状或 针状晶须,是 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 的形貌,但 XRD 分析表明氧 化膜中是 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 和 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 共存,且以 -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 为主.这种现象可能是由于未转变的 -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 覆盖在已形成的 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 表面,进行 XRD 分 析时,X - 射线衍射可穿透一定的深度探测到 -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 所致.

Brumm 等人<sup>[3]</sup>研究了 NiAl - Cr 合金的氧化行 为,发现氧化初期形成的 Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 可作为 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 的 形核场所,促进 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 转变. 溅射 NiCrAl Y涂 层经真空热处理后,1000 氧化 1 h,氧化物中只有 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>,可能是由于涂层经真空热处理后,表面富 铝且生成了少量 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub><sup>[7]</sup>,在氧化过程中为 -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 的形成提供形核场所,并促进 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 转 变,使涂层表面很快生成保护性的 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 膜.

4 结论

1 溅射 NiCrAl Y 涂层在 900 ~ 1100 氧化
 过程中,氧化膜存在 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 相变;其相变的速
 度与温度有关,温度越高,相变越快.

2 涂层表面生成的氧化膜形貌取决于氧化温 度和时间. - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 随着温度的提高或同一温度下 时间的延长,从针状依次变化为晶须状和刀片状或 簇拥成团;而 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 为颗粒状.

3 对溅射 NiCrAl Y 涂层进行真空热处理,可 促进氧化膜的相变,使涂层表面快速形成保护性的 - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.

**致谢** 感谢中国科学院金属研究所楼翰一研究员为制 备 NiCrAlY 涂层给予的热情帮助.

#### 参考文献:

- [1] Goward G W.J. of Metals ,1970 ,22(10) :31
- [2] Rybicki GC, Smialek J L. Oxidation of Metals, 1989, 31 (3/4) :
  275
- [3] Brumm M W, Grabke H J. Corrosion Science, 1992, 33 (1): 1677
- [4] Doychak J , Smialek J L , Mitchell T E. Metall. Trans. ,1989 , 20A:499
- [5] Schumann E. Oxidation of Metals ,1995 ,43 (1/2) :157
- [6 ]Doychak J ,R ühle M. Oxidation of Metals ,1989 ,31 (5/ 6) :431
- [7]李美姮,张重远,孙晓峰等.中国腐蚀与防护学报,2002,22(3):63